主要半導体材料ガス等国内販売実績5年推移

（暦年：2018年～2022年）

一般社団法人　日本産業・医療ガス協会

単位：kg

			2018年		2019年		2020年		2021年		2022年	
			数　量	前年比	数　量	前年比	数　量	前年比	数　量	前年比	数　量	前年比
1	アルシン	AsH3	9,600	94%	8,600	90%	8,800	102%	8,700	99%	5,900	68%
2	ジボラン	B2H6	490	136%	620	127%	750	121%	920	123%	2,000	217%
3	三塩化ホウ素	BCl3	160,000	94%	169,000	106%	171,100	101%	——		——	
4	四フッ化炭素	CF4	656,500	100%	581,200	89%	589,600	101%	654,000	111%	614,100	94%
5	三フッ化メタン	CHF3	96,900	103%	79,300	82%	91,200	115%	100,800	111%	110,000	109%
6	六フッ化エタン	C2F6	179,100	87%	142,300	79%	135,900	96%	139,800	103%	179,800	129%
7	八フッ化シクロブタン	C4F8	185,000	152%	228,200	123%	240,900	106%	335,200	139%	407,000	121%
8	塩素	Cl2	357,500	92%	324,900	91%	335,600	103%	373,000	111%	352,100	94%
9	ゲルマン	GeH4	240	100%	240	100%	——		——		——	
10	臭化水素	HBr	151,200	91%	137,800	91%	174,200	126%	212,200	122%	199,700	94%
11	アンモニア	NH3	2,901,200	92%	2,871,200	99%	4,402,100	153%	4,698,500	107%	2,045,800	44%
12	三フッ化窒素	NF3	1,665,200	127%	1,580,500	95%	1,780,500	113%	2,693,000	151%	2,352,000	87%
13	一酸化二窒素	N2O	1,029,800	88%	1,042,800	101%	1,139,300	109%	1,626,000	143%	1,688,700	104%
14	ホスフィン	PH3	7,500	101%	6,600	88%	6,700	102%	7,500	112%	7,400	99%
15	モノシラン	SiH4	348,000	114%	307,900	88%	339,500	110%	278,200	82%	301,900	109%
16	ジクロロシラン	SiH2Cl2	200,200	120%	174,600	87%	174,200	100%	168,200	97%	283,700	169%
17	四フッ化ケイ素	SiF4	7,000	100%	7,000	100%	7,000	100%	7,000	100%	7,000	100%
18	TEOS	(C2H5O)4Si	751,800	122%	809,100	108%	925,900	114%	1,037,500	112%	1,107,600	107%
19	六フッ化硫黄	SF6	215,000	100%	217,500	101%	214,900	99%	224,600	105%	237,500	106%
20	六フッ化タングステン	WF6	230,000	124%	213,500	93%	224,900	105%	241,700	107%	256,800	106%
21	有機金属		1,900	86%	——		——		——		——	